

참가 안내

▶ 참가신청방법 및 문의

담당자 : 정현희
Tel : 042) 868-5669 / Fax : 042) 868-5285
E-mail : hyunhee@kriss.re.kr

▶ 기타문의사항 윤주영 jyun@kriss.re.kr 042) 868-5624

참가비 : 무료

※ 사전 등록자에 한해서만 Workshop 자료를 드릴 수 있습니다.

▶ 참가의사가 있으신 경우,
아래에 인적사항을 기입하고 FAX 또는 관련 내용을 E-mail로 송부하여 주십시오.

제 4 회 반도체 공정 진단 Workshop			
성 명			
소 속		직 위	
휴대폰			
이메일			

 진공센터
Vacuum Center



 BLUE BUS 피랑(간선)버스

140, 405, 407, 408, 421,
440, 441, 462, 470, 471

 GREEN BUS 초록(지선)버스

4432

 RED BUS 빨강버스(광역노선)

9404, 9408, 9409, 9503

※ 지하철 3호선 양재역 또는 2호선 강남역에서 버스이용

제4회 반도체공정 진단 Workshop



일시 : 2010년 6월 29일 (화) 12시30분
장소 : 서울 서초구 양재동 AT센터
주최 : 한국표준과학연구원 진공기술센터
반도체공정진단 연구회

행 사 일 정

12:30 ~ 13:00	등록	
13:00 ~ 13:15	개회식	신용현 박사/한국표준과학연구원
	인사말	지식경제부 반도체디스플레이과

<초청강연>

시간	내용	발표자
		좌장 : 강상우 박사(표준연)
13:15 ~ 13:45	"차세대 로직공정 기술동향"	박문한 수석/삼성전자
13:45 ~ 14:10	"차세대 반도체용 진공공정 실시간 측정 진단 기술 개발 현황"	신용현 박사/한국표준과학연구원

14:10 ~ 14:50	포스터 발표	
---------------	--------	--

		좌장 : 백준걸 교수(고려대)
14:50 ~ 15:20	"반도체 설비의 In-situ 공정진단 사례"	이현정 수석/삼성전자
15:20 ~ 15:50	"설비 예지보전 현황과 향후 전망"	권혁진 부장/LG디스플레이
15:50 ~ 16:15	"반도체공정 이상탐지 및 클러스터링을 위한 심볼릭 표현법의 적용"	노웅기 교수/성결대학교

16:15 ~ 16:30	Coffee break	
---------------	--------------	--

		좌장 : 김정형 박사(표준연)
16:30 ~ 16:55	"반도체 공정 및 장비 진단을 위한 공간분해 발광분광기 개발"	한재원 교수/연세대학교
16:55 ~ 17:20	"플라즈마 진단 센서의 상업 적용 사례"	김정훈 차장/Inficon
17:20 ~ 17:45	"실시간 CVD 공정진단 SENSOR-SP OES-"	차동호 사장/나노텍

포스터 발표 program 14:10 ~ 14:50 p.m

- 식각 및 CVD 공정의 상태 변화를 감시하기 위한 진단 방법 개발 (박설혜, 김근호/서울대)
- Etcher용 상부전극의 life time평가 방법 연구 (노승완, 강상우, 윤주영/표준연)
- Plasma Uniformity Monitoring by Microwave Transmission Spectrum Analysis (나병근, 장홍영/KAIST)
- Zr 전구체의 잔량사용을 위한 평가 및 진단연구 (신진호, 윤주영, 강상우/표준연)
- 비선형 신호의 이상탐지 기법 (박정술, 백준걸/고려대)
- Effect of the sputtering gun size on the CNx film characteristics (노기민, 유신재, 김정형, 성대진/표준연)
- SiH4 열분해시 실리콘 나노입자의 생성/성장/이동 메커니즘의 수치해석적 규명 (우대광, 김태성/성균관대)
- 선택적증착을 위한 Co CVD 전구체 및 공정진단연구 (서경천, 윤주영, 강상우/표준연)
- 저압 광산란 실시간 오염입자 측정장비 개발 (문지훈, 김태성/성균관대)
- Energy Consumption Characteristics of Low Dry Pumps in Semiconductor Manufacturing (신진현, 강상백, 정완섭, 임종연/표준연)
- Radial Basis Function Neural Network Model for Endpoint Detection in Plasma Etch process (김민우, 홍상진/명지대)
- The pressure dependance of the metastable argon density in ICP discharges ('¹박민, '²유신재, '¹김정형, '¹성대진, '¹신용현, '²장홍영/ 표준연', KAIST²)
- TMP 1000L/s급 database 구축 및 종합특성평가시스템 진단 기술 개발 (강상백, 신진현, 정완섭, 임종연/표준연)
- 차세대 공정 진단을 위한 데이터에 대한 원인분석 (이세원/비스텔)
- An analysis of a cut-off probe characteristic using microwave simulation ('¹김대웅, '²유신재, '²김정형, '²성대진, '²신용현, '¹장홍영/KAIST¹, 표준연²)
- 비간섭식 공정 플라즈마 측정장치 (이신형/피앤에이 솔루션즈)
- (주) 테스 장비개발현황 (박근오/테스)
- PECVD 공정변수 중 발생하는 실시간 오염입자 비교측정 (전기문, 윤주영, 강상우/표준연)